

In-line连续式磁控溅射镀膜生产线

产品名称	In-line连续式磁控溅射镀膜生产线
公司名称	昆山金柏集成电路有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昆山立特纳米 型号:LX1200
公司地址	玉山镇城北环庆路28号
联系电话	86 0512 57735896 18962686798

产品详情

品牌	昆山立特纳米	型号	LX1200
用途	磁控溅射PVD镀膜，氮化钛（TiN）、氮碳化钛（TiCN）、氮化锆（ZrN）、氮化铬（CrN）、氮化铝钛（TiAlN）、碳化钛（TiC）等	别名	磁控溅射镀膜机

用途：磁控溅射pvd镀膜，氮化钛（tin）、氮碳化钛（ticn）、氮化锆（zrn）、氮化铬（crn）、氮化铝钛（tialn）、碳化钛（tic）等

基材：不锈钢,锌合金,塑料

应用：手机外壳，mp3外壳，数码相机外壳，各种标牌的装饰改性加硬镀膜

颜色：白色，金色，银色，黑色，兰色等

基本参数：

- 1、真空室尺寸：1210mm（直径）×1200mm（高）；
- 2、抽气时间速：大气到 5×10^{-3} pa 20min（空载,冷态,洁净）；
- 3、最高烘烤温度:300
- 4、极限真空：优于 1×10^{-3} pa；
- 5、采用侧面对开门方式,便于工件装卸；

- 6、3只观察窗口，左右门上各一个，室体正前方一个；
- 7、2台 400mm口径分子泵、1台zjp300型罗茨泵，2台2x-70型机械泵抽气；
- 8、一套公、自转工转机构，采用下驱动方式的二维平面行星机构；自转轴20根；
- 9、所有驱动引入采用带水冷套磁流体密封；
- 10、四对磁控溅射靶平行安装且成圆周分布，靶材尺寸：910mm × 120mm（长 × 宽）；
- 11、4路进口质量流量计进气；
- 12、预溅射小车挡板，控制预溅射工艺；
- 13、三台30kw中频电源及一台30kw脉冲偏压电源；
- 14、控制系统采用触摸屏上位机（工控机）+下位机（plc）的控制形式
- 15、控制系统有手动和自动，全系统具有互保护, 泵阀互锁。

特点和应用：

采用真空磁控溅射，孪生阴极，中频溅射技术，并配以先进的控制系统，可以在工程塑料，玻璃和金属表面镀制单质金属膜、复合膜、电磁屏蔽膜、ito膜。生产过程全部自动，可以实现连续高效率的磁控溅射镀膜。生产线可以根据需要配置多个真空室，采用立式或卧式，每个真空室根据需要配置不同的靶材，室与室之间采用独立的真空抽气系统，可以随意调节各个真空室的气体参数，镀制不同的膜层，可以满足工业化连续生产的需要。广泛应用于玻璃、pmma、电子屏蔽，装饰，ito等各种镀膜领域。

主要组成部分：

真空室：不锈钢制造，立式或卧式，外壁通冷却水，内衬不锈钢挡板。

真空系统：分子泵系统。

溅射源：平面磁控溅射阴极，孪生靶技术，直流脉冲和中频溅射电源。

等离子轰击：射频或中频放电，对有机材料基片进行等离子改性，以增强膜层附着力。

工件烘烤：采用不锈钢管状加热器配合均热板，确保基片加热均匀性。

充气系统：气体质量流量计和压强自动控制仪。

电气控制系统：触摸屏+plc自动控制，工艺过程控制全自动化。

水冷系统：真空室冷却和阴极冷却，有水压保护开关和水流开关